

基肥全量施肥法の施肥位置と大豆の収量

福島県農業試験場 種芸部
平成17年度研究報告

1 部門名 普通作物—大豆—施肥・作型・栽培型・雑草発生資源利用
分類コード 02-05-13181900

2 担当者 二瓶直登

3 要旨

大豆栽培において、肥効調節型肥料を用いて追肥を省略した基肥全量施肥法と、施肥位置の違いが湿害時の収量確保や雑草発生を抑制することを明らかにした。

(1) 基肥時に硫安またはLP30と、シグモイド型肥効調節型肥料 (LPS80) を同時に施用することで、追肥を省略した基肥全量施肥が可能である。

(2) 通常の施肥法と比較して、基肥全量施肥の施肥窒素利用率は高い。

(3) 基肥全量施肥の施肥位置と収量の関係は、排水良好なほ場では全層・側条施肥で同等であるが、湿害により生育が阻害される場合には、側条施肥の方が低下しにくい。

(4) 雑草の発生量は、全層施肥より側条施肥が少ない。

4 その他の資料など